2020年度大学院博士前期課程入学試験

大阪大学大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻

専門科目試験問題 (電子エ学コース)

(実施時間 14:00 ~ 16:00)

【注意事項】

- 1. 問題用紙は、この表紙や白紙を除いて20ページある. 解答開始の指示があるまで開いてはいけ ない. 解答開始後, 落丁や不鮮明な箇所等があった場合は、手を挙げて監督者にその旨を伝える こと.
- 2. 試験問題は、「量子電子物性1」、「量子電子物性2」、「量子電子物性3」、「量子電子物性4」、「制 御工学」、及び、「信号処理」、の全部で6題あり、この順番に綴じられている. このうち、3題を 選択し解答すること.
- 3. 解答開始前に、別紙の「専門科目試験問題選択票」に記載の注意事項も読んでおくこと.
- 4. 問題用紙は持ち帰ってもよい.

【量子電子物性1】 解答は、桃色(1番)の解答用紙に記入すること.

量子力学に関する次の文章を読み、下記の問いに答えよ.ただし、プランク定数hを 2π で割った値を \hbar 、虚数単位をiとする.

3 辺の長さが*a*, *b*, *c* である直方体の箱の中に閉じ込められ た一つの量子力学的自由粒子(質量:*m*)の状態を,図1-1に示 した直交座標(*x*,*y*,*z*)で考える.ここで,箱の外のポテンシャル は無限大とする.箱の中については,粒子に力は作用していない ので,式(1)に示す時間に依存しないシュレーディンガー方程式 に従うとして解くことができる.



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\varphi(x, y, z) \equiv H\varphi(x, y, z) = \varepsilon\,\varphi(x, y, z) \tag{1}$$

ここで、 $\rho(x, y, z)$ と ε は、それぞれ、この方程式の固有関数と固有値である.また、

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$$
(2)

とおいた. 一般にハミルトニアンと呼ばれるこのHは [⑦] を表す演算子である. いま,Hはx,y,zだけに関係した項の和となっていることから,その固有関数 $\varphi(x,y,z)$ は

$$\varphi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$$
(3)

の形に書き表すことができる.式(3)を式(1)に代入して両辺の各項を関数X(x)Y(y)Z(z)で割り、左辺についてはそれぞれx, y, zのみを含む項の和として整理すると、

$$\begin{bmatrix} & \textcircled{1} & \boxed{} = -\frac{2m}{\hbar^2}\varepsilon \tag{4}$$

と変数分離できる.式(4)の右辺は定数であること、また、x、y、zは互いに独立な変数であることから、左辺の変数分離したいずれの項もそれぞれが定数でなければならない.いま、xのみを含む項について考え、その定数を $-k_x^2$ (k_x は実数)とおくと、

$$\begin{bmatrix} & 2 & \end{bmatrix} = -k_x^2 \tag{5}$$

が得られる. $\varphi(x, y, z)$ の満たすべき境界条件を考慮すると、X(x)については

$$X(0) = X(a) = \begin{bmatrix} & 3 \end{bmatrix}$$
(6)

が要求される.式(5)の微分方程式の一般解の中で物理的に意味をもつ解の一つは, AとBを負ではない 任意定数として,

$$X(x) = A\sin k_{\rm r} x + B\cos k_{\rm r} x \tag{7}$$

と書き表される.式(5)に対する境界条件と規格化条件から

$$A = \begin{bmatrix} & 4 & \end{bmatrix} \tag{8}$$

$$B = \begin{bmatrix} & (5) & \end{bmatrix} \tag{9}$$

$$k_{\rm r} = \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix} \times n_{\rm r} \tag{10}$$

が得られる. ここで, n_rは正の整数である.

Y(y), Z(z)についても同様にして解くことができ,式(10)の n_x に対応する正の整数を,それぞれ n_y , n_z とおくと,固有関数,固有値として

$$\varphi(x, y, z) = \begin{bmatrix} & 7 & \end{bmatrix}$$
(11)
$$\varepsilon(n_x, n_y, n_z) = \begin{bmatrix} & 8 & \end{bmatrix}$$
(12)

が得られる. n_x , n_y , n_z は正の整数であるから,式(12)の ε の値は離散的となる. このように,離散的 な固有状態に番号付けをする n_x , n_y , n_z のような数は [①]数と呼ばれる. ε が最小となるの は, $n_x = n_y = n_z =$ [⑨]の場合であり,正の有限の値をとることが分かる. このことは,箱の 中に閉じ込められた量子力学的自由粒子は,エネルギーが最低の基底状態でも有限の運動エネルギーを もって動き回っていると解釈できることを表しており,このエネルギーを[⑦]エネルギーと呼ぶ.

- 問1 文章中の空欄[⑦]~[⑦]にあてはまる語句を,空欄[①]~[⑨]
 にあてはまる数値または数式を答えよ.
- 問2 $\varphi(x,y,z)$ の満たすべき境界条件から、X(x)については式(6)が要求される. その物理的根拠を 40 字程度で答えよ.
- 問3 a=b=cの場合について、励起状態の中で最もエネルギーの低い状態の組 (n_x, n_y, n_z) をすべて答 えよ.
- 問4 基底状態の固有関数と固有値を、それぞれ $\varphi_1 \ge \varepsilon_1 \ge tack > H \varepsilon_1 \ge (H \varepsilon_1)^2$ の期待値 $\langle H \varepsilon_1 \rangle$, $\langle (H \varepsilon_1)^2 \rangle$ は、いずれも0であることを示せ.

問5 基底状態にある粒子の運動量の
$$x$$
方向成分 $p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ について、 $p_x \ge p_x^2$ の期待値がそれぞれ $\langle p_x \rangle = 0, \ \langle p_x^2 \rangle = (\hbar k_x)^2 \ge c$ なることを示せ.

問6 問4,5の結果をもとに、箱の中に閉じ込められた量子力学的自由粒子の状態を、そのエネルギー と運動量の観点から説明せよ。

量子力学:	quantum mechanics
プランク定数:	Planck constant
虚数単位:	imaginary unit
直方体:	rectangular parallelepiped, cuboid
箱:	box
自由粒子:	free particle
質量:	mass
直交座標:	orthogonal coordinates
無限大:	infinite
ポテンシャル:	potential
時間に依存しないシュレーディンガー方程式:	time-independent Schrödinger equation
固有関数:	eigenfunction
固有值:	eigenvalue
演算子:	operator
変数分離:	separation of variables
実数:	real number
境界条件:	boundary condition
微分方程式:	differential equation
— 般解:	general solution
規格化:	normalization
整数:	integer
離散的:	discrete
有限:	finite
基底状態:	ground state
励起状態:	excited state
期待值:	expectation value
運動量:	momentum

【量子電子物性2】 解答は、緑色(2番)の解答用紙に記入すること.

次の半導体物性に関する文章を読んで、以下の問いに答えよ.なお、 \hbar はプランク定数hを 2π で割ったものである.

シリコン半導体の単結晶は[⑦]型構造をしており,各原子の最外殻電子は4個の最近接原子 と[⑦]結合をしている.一つの原子に注目すると,まわりの8個の最外殻電子で閉殻構造を形 成しており,これ以上の電子をつめることができない.この状態の電子は[⑦]帯を形成し,絶 対零度では満ちたエネルギーバンドになっている.このとき,禁止帯をへだててその上に空の [④]帯が存在し,温度が上昇するにつれ,[⑦]帯から[④]帯に電子が励 起され,電子は[⑦]帯の正孔とともに電気伝導に寄与する.このような場合には,電子と同数 の正孔がつくられており,このような半導体を[⑦]半導体と呼ぶ.

[⑦] 半導体に、禁止帯幅のエネルギー εgを超えるエネルギーを持つ光が入射すると、
 [⑦] 結合を切って、電子と正孔がつくられる. [F線1]ある半導体では、[⑨] 帯の底と
 [⑦] 帯の頂上が同じ波数 k のところにあり、光を吸収すると電子と正孔がほぼ同じ波数のところに励起される. このような遷移過程を [⑦] 遷移と呼ぶ. 一方、[⑨] 帯の底と
 [⑦] 帯の頂上が同じ波数のところにはなく、光だけでは励起できずに、同時に [⑨]
 の吸収や放出をともなって、電子と正孔を励起する場合の遷移過程を [⑦] 遷移とよぶ.

[Ξ]帯の底のエネルギーを ε_c とし、電子の有効質量を m_n 、[ூ]帯の頂上のエネル ギーを ε_v とし、正孔の有効質量を m_p とすれば、波数kの電子と正孔のエネルギー $\varepsilon_n(k)$ 、 $\varepsilon_p(k)$ はそれ ぞれ、

$$\varepsilon_{\rm n}\left(k\right) = \varepsilon_{\rm c} + \begin{bmatrix} & \textcircled{1} & \end{matrix}, \qquad (1) \qquad \qquad \varepsilon_{\rm p}\left(k\right) = \varepsilon_{\rm v} - \begin{bmatrix} & \textcircled{2} & \end{matrix} \qquad (2)$$

と書ける.ただしこれは、電子は[①]帯の底,正孔は[⑦]帯の頂上に近い部分のみの近似である.

金属の自由電子を考えたとき、エネルギー ε と ε + $d\varepsilon$ の間にある単位体積中の状態の数 $g(\varepsilon)d\varepsilon$ は、 スピンを考慮して、

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon}d\varepsilon$$
(3)

で与えられる.ここで, m は金属中の自由電子の有効質量である.一方,半導体では禁止帯があり,キャリアの有効質量が自由電子と異なるために,エネルギー $\varepsilon \ge \varepsilon + d\varepsilon$ の間にある単位体積中の電子の状態の数 $g_{n}(\varepsilon)d\varepsilon$ と正孔の状態の数 $g_{p}(\varepsilon)d\varepsilon$ は, ε , ε_{c} , ε_{v} , m_{n} , m_{p} , \hbar を用いて, それぞれ,

 $g_{n}(\varepsilon)d\varepsilon = [$ (3)] $d\varepsilon$, (4) $g_{p}(\varepsilon)d\varepsilon = [$ (4)] $d\varepsilon$ (5)

と表すことができる.

電子および正孔は [⑦] の排他律にしたがい,エネルギー ε の状態を占める占有確率は, [②] 分布関数で表される.そこで [④] 帯の全電子密度n と [⑦] 帯の全正 孔密度pは、全エネルギー範囲で積分すれば求めることができる.電子の占有確率を $f_n(\varepsilon)$ 、正孔の占 有確率を $f_p(\varepsilon)$ として、

$$n = \int_{\varepsilon_{\rm c}}^{\infty} g_{\rm n}(\varepsilon) f_{\rm n}(\varepsilon) d\varepsilon, \qquad (6) \qquad p = \int_{-\infty}^{\varepsilon_{\rm v}} g_{\rm p}(\varepsilon) f_{\rm p}(\varepsilon) d\varepsilon \qquad (7)$$

となる.ここで、 $f_{n}(\varepsilon) \ge f_{p}(\varepsilon)$ はフェルミ準位を ε_{F} 、ボルツマン定数を k_{B} 、温度をTとして、 $f_{n}(\varepsilon) = \frac{1}{1 + \exp((\varepsilon - \varepsilon_{F})/k_{P}T)}, (8) \qquad f_{p}(\varepsilon) = [5]$ (9)

と記述できる.

室温近傍にある [⑦] 半導体では *ε*_Fは禁止帯中の中央付近にあるため, [◎] 分布関数は, [⑦] 分布関数で近似できるので,

 $f_{n}(\varepsilon) \approx [], \quad (10) \quad f_{p}(\varepsilon) \approx [] \quad (11)$

と書ける.式(6),(7)に [⑦] 分布関数を代入して,

$$n = N_{\rm c} \exp\left(- \begin{bmatrix} \otimes & \end{bmatrix}\right), \quad (12) \qquad p = N_{\rm v} \exp\left(- \begin{bmatrix} & \odot & \end{bmatrix}\right) \quad (13)$$

と計算できる. [F # 2] ここで, N_c , N_v はそれぞれ, [\Box] 帯および [\bigcirc] 帯の有効状態 密度である.

この結果より, $n \ge p$ の積は禁止帯幅のエネルギー \mathcal{E}_{g} の関数として,

$$np = N_c N_v \times \begin{bmatrix} & 0 \end{bmatrix}$$
(14)

と求められる. [⑦] 半導体では、電気的中性条件から、 n = p であるので、

$$\varepsilon_{\rm F} = \frac{\varepsilon_{\rm c} + \varepsilon_{\rm v}}{2} + [\qquad (1) \qquad] \tag{15}$$

と求められる.

問1 文章中の空欄[⑦]~[⊕]にあてはまる最も適した語句を,下記の表から選べ.

ホッピング,フェルミ,ボース,スピン,ド・ブロイ,アインシュタイン,コーン,ボルツマン, 間接,直接,真性,中性,アクセプター,ヘキサゴナル、ドナー,ダイヤモンド,ウルツ鉱, ペロブスカイト,イオン,ヘテロ,伝導,電荷,価電子,トンネル,パウリ,フォトン, フォノン,プロトン,ボーア,アボガドロ,磁性,共有,金属,ファンデルワールス

- 問2 文章中の空欄 [①]~[⑪]にあてはまる数式を答えよ.
- 問3 文章中の[下線1]について,[⑦]遷移型半導体と[⑦]遷移型半導体のエネル ギーバンド構造(波数kとエネルギーεの関係)を図示せよ.ただし,[②]帯は最下位 にある電子に対するバンド,[⑦]帯は最上位近傍にある有効質量の重い正孔と軽い正孔 の2種類の正孔に対するバンドを図示し、どちらが軽い正孔と重い正孔に対応するバンドかにつ いても記せ.
- 問4 以下の(A), (B)の問いに答えよ.ただし、 \mathcal{E}_{g} の温度依存性は無視するものとする.
 - (A) [⑦] 遷移型半導体に対して、室温付近で、 *ε*gより少し大きいエネルギーの光を入射すると有限の吸収率(単位厚さ当たり)を示していたが、低温に冷やすと、吸収率が減少した.
 "低温に冷やすと、吸収率が減少したのは何故か?"説明せよ.
 - (B)上述の状態から、光の波長を短くしていくと、少しずつ吸収率が増大するが、ある波長以下で突然吸収率が大きくなった."ある波長以下で突然吸収率が大きくなったのは何故か?"、波長とエネルギーの関係と上記問3の[⑦] 遷移型半導体のエネルギーバンド構造とあわせて説明せよ.
- 問5 文章中の [下線2] について、 $N_{\rm c}$ および $N_{\rm v}$ を求めよ.ただし、次の公式を用いてよい。また、バレーの数は考慮しなくてよい.

$$\int_0^\infty \sqrt{x} \exp(-ax) \, dx = \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

量子電子物性2 単語の英訳

プランク定数:	Planck constant
最外殼電子:	outermost electron
閉殼構造:	closed shell structure
禁止带:	band gap
遷移過程:	transition process
有効質量:	effective mass
波数:	wave number
排他律:	exclusion principle
分布関数:	distribution function
占有確率:	occupancy probability
フェルミ準位:	Fermi level
有効状態密度:	effective density of states
電気的中性条件:	electrical neutrality condition
間接:	indirect
直接:	direct
真性:	intrinsic
中性:	neutral
ウルツ鉱:	wurtzite
伝導:	conduction
電荷:	charge
価電子:	valence electron
磁性:	magnetic
共有:	covalent
金属:	metal
吸収率:	absorption rate

【量子電子物性3】 解答は、灰色(3番)の解答用紙に記入すること.

誘電体に関する次の文章を読み、下記の問いに答えよ.ただし、真空の誘電率を ε_0 、素電荷をe、虚数 単位をj、時間をtとする.

[I] 誘電体に電界を加えると、内部に分極が誘起される.分極 はその発現機構からいくつかの種類に分類され、電荷のずれによ って生じる変位分極には電子分極とイオン分極の2種類がある.

以下では、立方晶のイオン結晶内で生じるイオン分極を中心 に考察する.いま、結晶格子は電荷 +Ze、-Zeをもった2種類 の正負イオン(質量 M_+ , M_-)からなっており、交流電界が作 用して正負イオンがそれぞれ平衡位置から \mathbf{u}_+ , \mathbf{u}_- だけ変位し たとする.このイオン間に発生した相対変化により、イオン対 に双極子モーメント



 $\mu_i = []$

(1)

が誘起される.隣接イオンが互いに反対方向に変位する振動様式は [⑦]分枝(あるいは [⑦]振動様式)と呼ばれる.変位したイオン対が結晶の単位体積中に*N*個あるとすると、イオン分極**P**は式(1)の右辺を用いて

$$\mathbf{P}_{i} = \begin{bmatrix} & 2 \end{bmatrix}$$
(2)

と表される.

次に図 3-1 に示す正負イオンを考え,時間*t* で変化する角周波数 ω の交流電界 $\mathbf{E}_{loc} \exp(-j\omega t)$ を局所 電界としたときの運動方程式から, \mathbf{E}_{loc} と平行な方向の変位量 $(\mathbf{u}_{+}-\mathbf{u}_{-})$ を求める.ここでは,イオンの 熱振動は無視できるとする.相対的変位が起こるとイオン間に復元力が働くが,簡単のためイオンは変 位方向の隣接イオンのみと相互作用し,ばね定数 k_0 で連結されているものとする.すなわちイオン対に は変位 $(\mathbf{u}_{+}-\mathbf{u}_{-})$ に比例する復元力

$$2k_0(\mathbf{u}_+ - \mathbf{u}_-) = M_r \omega_r^2(\mathbf{u}_+ - \mathbf{u}_-)$$
(3)

が働くものとみなす. なお、 M_r は還元質量 $M_r = M_+M_-/(M_+ + M_-)$ を、 ω_r は共振角周波数で $\omega_r = \sqrt{2k_0/M_r}$ である. 減衰の項を無視すると、運動方程式は

$$M_{\rm r}\left(\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{u}_+ - \frac{d^2}{dt^2}\mathbf{u}_-\right) + 2k_0(\mathbf{u}_+ - \mathbf{u}_-) = Ze\mathbf{E}_{\rm loc}\exp(-j\omega t)$$
(4)

と表されるとする.式(3), (4)からその解は, $M_{\rm r}$ と $\omega_{\rm r}$ を用いて

$$\mathbf{u}_{+} - \mathbf{u}_{-} = \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix} \times \mathbf{E}_{\text{loc}} \exp(-j\omega t)$$
(5)

となる.式(5)の右辺を用いると、イオン分極率α,は

$$\alpha_{i} = [4] \tag{6}$$

と書ける.

一方,誘電体の巨視的物理量である比誘電率と,物質中の各構成要素に着目した微視的な分極率との関係式は[⑦]の式として知られている.イオンは原子核のまわりに電子をもっているため,分極にはイオン分極に加え,電子分極の寄与がある.そこで,正負イオンの電子分極率をそれぞれ α_+ , α_- とすると,イオン分極,電子分極を考慮した [⑦]の式は,比誘電率を $\kappa(\omega)$ とし, α_i を用いて

$$\frac{\kappa(\omega) - 1}{\kappa(\omega) + 2} = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$$
(7)

となる.ただし、局所電界にはローレンツ電界が適用され、局所電界係数を1とする.次に、 $\omega = 0$ のときの比誘電率を κ_0 、 $\omega >> \omega_r$ なる角周波数に対する比誘電率を κ_∞ として、比誘電率 $\kappa(\omega)$ を求めると

$$\kappa(\omega) = \kappa_{\infty} + \frac{\kappa_0 - \kappa_{\infty}}{1 - (\omega/\omega_{\Gamma})^2} , \qquad (8)$$
$$\omega_{\Gamma}^2 = \frac{\kappa_{\infty} + 2}{\kappa_0 + 2} \omega_{\Gamma}^2 \qquad (9)$$

 $- 般に, \omega_{\rm T} \, \iota \begin{bmatrix} \textcircled{m} \\ \textcircled{m} \end{bmatrix} \\$ 】 振動の角周波数と呼ばれる. $\kappa(\omega) = \begin{bmatrix} \textcircled{m} \\ \textcircled{m} \end{bmatrix} \\$ 】 振動の角周波数と呼ばれる. $\kappa(\omega_{\rm L}) = \begin{bmatrix} \textcircled{m} \\ \textcircled{m} \end{bmatrix} \\$ の条件から,

$$\left(\frac{\omega_{\rm L}}{\omega_{\rm T}}\right)^2 = \begin{bmatrix} & \textcircled{7} & \end{bmatrix}$$
(10)

の関係が導かれる.この関係を [⑦]の式と呼ぶ.

角周波数 ω_{T} を中心に比誘電率(実数部)をプロットする と、図 3-2 となる.ここで、 $\omega_{T} < \omega < \omega_{L}$ の領域で $\kappa(\omega)$ は [⑦ 正、ゼロ、負] となるため、イオン結晶に対して 入射するこの範囲の角周波数の電磁波は [⑤] さ れる.なお、 $\kappa_{0} - \kappa_{\infty}$ は [⑦ 電子、イオン] 分極の寄与 を表し、 κ_{∞} は [⑦ 電子、イオン] 分極の寄与を表す.



[Ⅱ] 強誘電体は内部に [□] 分極を有し, 電界印加によってその向きを変えることができる. [F線1]強誘電体に電界を加えた場合,誘起される分極を電界に対して図示すると,特徴的な閉曲線を示す. また、この物質の特徴としてキュリー温度で [□] 分極を失い、 [⑦] 相に変化するこ とが知られている.キュリー温度より数度低い [⑦]性キュリー温度(もしくは特性温度)と呼 ばれる温度 T_0 より高温の温度Tにおいて、[\oplus]相の比誘電率 $\kappa(T)$ は、一般にキュリー定数Cを用いて

 $\kappa(T) = \begin{bmatrix} & \otimes & \end{bmatrix}$

(11)

で近似的に表される.これをキュリー・ワイスの法則とよぶ.2次相転移を示す強誘電体では、Toはキュ リー温度と等しくなる.

その他に、機械的な力を加えることで分極が変化する物質を特に [②]物質といい、水晶やチ タン酸バリウムなどが知られている.

- 問1 文章中の空欄[⑦]~[②]にあてはまる語句を答えよ.ただし,空欄[⑦], ⑦], [⑦] は適切な語句を一つ選ぶこと. Γ
- 問2 文章中の空欄 [①]~[⑧]にあてはまる数式または数値を答えよ.
- 問3 文章中に出てくる図 3-2 を解答用紙に転記し、横軸を角周波数ωとしたときの比誘電率κ(ω)の角 周波数依存性を示すグラフの概形を図示せよ. ただし、κ₀とω_Lもそれぞれ縦軸と横軸に記入す ること.
- 問4 文章中の [下線1] について考える. 初期状態で分域の [3] 分極の方向は強誘電体内部 でランダムに分布し、全体として分極がないとする.図 3-3 を解答用紙に転記し、電界 Eを±E,の 間において $0 \rightarrow E_1 \rightarrow -E_1 \rightarrow E_1$ の順で掃引したとき Pの分極 P と電界 E の関係を示す P - E 曲線の様子を グラフに示し, 閉曲線の特徴が分かるように概形を図 示せよ. ただし、±E₁を印加したとき強誘電体内部の 全分極の方向は揃っているものとする.また,この現象 0 E_{\cdot} について分極の変化の様子を簡潔に説明せよ.



量子電子物性3 単語の英訳

誘電体: dielectric 誘電率: permittivity 素電荷: elementary charge 虚数単位: imaginary unit 電界: electric field 分極: polarization 電子分極: electronic polarization イオン分極: ionic polarization イオン結晶: ionic crystal 交流電界 alternating electric field 平衡位置: equilibrium position 双極子モーメント dipole moment 角周波数: angular frequency 局所電界: local electric field 分極率: polarizability 比誘電率: relative permittivity 局所電界係数: local electric field coefficient 強誘電体: ferroelectric 2 次相転移: second-order phase transition 機械的な力: mechanical stress 分域: domain

【量子電子物性4】 解答は, 青色(4番)の解答用紙に記入すること.

半導体デバイスに関する次の文章を読み、下記の問いに答えよ.ただし、素電荷はq、プランク定数は h、真空の誘電率は ε_0 、半導体における電子密度はn、正孔密度はp、アクセプタ密度は N_A 、ドナー密 度は N_D 、電子移動度は μ_n 、正孔移動度は μ_p 、電子の拡散係数は D_n 、正孔の拡散係数は D_p 、比誘電率 は κ によって表されるものとする.

[I] 半導体デバイスの動作はデバイス内部の静電界,電流密度,および連続の式を考えることで理解で きる.まず,静電界について考えると,一般的に,電荷密度 *ρ*と電束密度 **D**はガウスの法則によって結び 付けられる.ガウスの法則の微分形は以下の式により与えられる.

$$\begin{bmatrix} & \textcircled{1} & \end{matrix}$$
(1)

式(1)より,デバイス内部の電位ψに対して成立するポアソン方程式が求められる.以下では簡単のため,半導体デバイスはx軸を空間軸とする一次元問題としてモデル化できるものとする.ドーパントが全てイオン化した半導体中で具体的に存在し得る電荷を考慮すると,ポアソン方程式は以下の形として得られる.

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\frac{q\left(N_{\rm D} - N_{\rm A} + p - n\right)}{\varepsilon_0\kappa} \tag{2}$$

次に、半導体デバイス中を流れる電流密度について考える.デバイスを流れる電流には、主な寄与として拡散とドリフトによるものがある.拡散電流はキャリア密度の勾配に起因し、その電流密度は拡散係数に依存する.一次元問題としてモデル化した半導体デバイスでは、電子および正孔に由来する拡散電流密度J_{in}、J_{in}は以下の式で与えられる.

$$J_{\rm ln} = \begin{bmatrix} & 2 & \end{bmatrix}$$

$$J_{\rm lp} = \begin{bmatrix} & 3 & \end{bmatrix}$$
(3)
(4)

一方,ドリフト電流はキャリアが電界によって輸送されることで生じる.印加された電界の大きさを E(x)とすると、電子および正孔に由来するドリフト電流密度 J_{2n} , J_{2p} は以下の式で与えられる.

$$J_{2n} = \begin{bmatrix} & 4 & \\ & & \end{bmatrix}$$
(5)
$$J_{2p} = \begin{bmatrix} & 5 & \\ & & \end{bmatrix}$$
(6)

半導体デバイス中の全電流密度は上述の寄与分をすべて足し合わせることで与えられる.キャリア生 成や再結合などの過渡的な現象が生じた際のキャリア数の変化は、考えている領域における電流連続の 式に加え、電子正孔対の生成または再結合を考えれば求まる.単位時間および単位体積あたりの電子お よび正孔の生成数をそれぞれ*G*_n, *G*_p, そして再結合数をそれぞれ*R*_n, *R*_pとし,さらに、電流を表す式 (3), (4), (5), (6)を考慮すると、半導体デバイス中のキャリア数の時間的変化は5項の和として表される. すなわち、電子と正孔についてそれぞれ以下の式が成り立つ.

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \begin{bmatrix} & 6 & \end{bmatrix}$$
(7)
$$\frac{\partial p}{\partial t} = \begin{bmatrix} & 7 & \end{bmatrix}$$
(8)

[Ⅱ] 半導体光デバイスの一つとして p-n ホモ接合フォトダイオードを考え,生成される光電流 J_{tot}を解析する.一般的にフォトダイオードには逆バイアスが印加され,光照射により生成される電子正孔対が引き離されることで電流が生ずる.
ここでは簡単のため,図4-1に示すように,光が p型半導体側から入射し,x軸方向に伝搬する一次元モデルを用いて解析する.なお,空乏領域を除く p型半導体領域(p型中性領域)は十分薄く,空乏領域に到達するまで半導体内部での光



吸収は無視できることとし、半導体のバンドギャップエネルギー ε_g 、および吸収係数 α はキャリア密度に依存しないとする.また、p型半導体における空乏領域端をx=0とする.

断面積Aのフォトダイオードに一様にパワー P_0 ,周波数 $v(hv > \varepsilon_g)$ の光が照射される場合を考える. デバイス表面での反射率Rの影響を考慮すると、空乏領域に到達する単位時間および単位面積あたりの 光子数 ϕ_0 は [⑧] で与えられる.その後、空乏領域を伝搬するにつれ、光子数は吸収によって 指数関数的に減衰する.一つの光子の吸収により 1 対の電子正孔対が生成されるとすると、空乏領域の 位置xにおける単位時間および単位体積あたりの電子正孔対生成数 $G_a(x)$ は以下のように求まる.

$$G_{e}(x) = [9]$$

$$(9)$$

簡単のため、 $[_{\Gamma \gg 1}]$ 空乏領域で発生した電子正孔対の外部量子効率は1であると仮定すると、発生する 光電流 J_{dr} は、 $G_{e}(x)$ を空乏領域である $x=0 \sim W_{D}$ の範囲で積分した値と素電荷の積で与えられる.

$$J_{\rm dr} = -q \int_0^{w_{\rm D}} G_{\rm e}(x) dx = [\qquad (10)]$$
 (10)

実際のデバイスでは、上記の空乏領域以外に、n型中性領域($x > W_{\rm D}$)でも光吸収が生じ、電子正孔 対が生成される.n型中性領域における少数キャリア(正孔)の一部は空乏領域に進入し、光電流に寄与 する.その結果、生じる全電流 $J_{\rm tot}$ は、n型半導体における正孔の拡散長 $L_{\rm p}$ を用いて、近似的に以下の式 で与えられる.

$$J_{\text{tot}} \approx q \Phi_0 \left[1 - \frac{\exp(-\alpha W_{\text{D}})}{1 + \alpha L_{\text{p}}} \right]$$
(11)

上式は、「F線2]フォトダイオードから大きな光電流を得るための設計指針を与える.

- 問1 文章中の空欄 [①] ~ [⑩]に当てはまる数式または等式を答えよ.
- 問2 半導体デバイスの具体的な解析例として,図4-2に示すような,接合面において電荷密度が不連続に変化する階段接合 p-n デバイスを考える.ここでは接合面をx=0とし,空乏領域 $(-x_p \le x \le x_n)$ 端に生じる電位差 ψ_{bi} (拡散電位)を求める.簡単のため,デバイスは一次元問題としてモデル化できるとし,ドーパントはすべてイオン化していること,また,半導体の比誘電率はドーパント密度によらず一定値 κ をもつことを仮定する.



図 4-2

空乏領域において電気的中性条件が成り立つこと、また、空乏領域端において電界は 0 となることを利用すれば、ポアソン方程式より出発して ψ_{bi} が得られる. ψ_{bi} を求めよ.なお、解答には計算過程を示すこと.

- 問3 文章中の [下線1] で示した仮定の具体的な内容を簡潔に述べよ.
- 問4 文章中の [下線2] で示した、フォトダイオードから大きな光電流を得るために有効なデバイス設計上の工夫について、考えられるものを二つ挙げ、それぞれについて式(11)を参照しながら理由を述べよ、ただし、キャリアの拡散長、および空乏層幅は変わらないものとする.
- 問5 フォトダイオードの吸収スペクトルは半導体のエネル ギーバンド構造に依存するため、測定しようとする目的 の波長帯によって適切な材料を選択する必要がある.図 4-3 に、可視~近赤外波長域で利用可能な半導体材料で ある、Si, Ge, GaAs の吸収係数スペクトルを示す.図4-3 に示した三つのトレースのうち、どれがどの半導体材料 に対応するか答え、簡潔にその理由も述べよ.



図 4-3

素電荷: プランク定数: 真空の誘電率: 電子: 正孔: 密度: 移動度: 拡散係数: フェルミ準位: 比誘電率: 静電界: 電流密度: 連続の式: 電荷密度: 電束密度: ガウスの法則: 電位: ポアソン方程式: 一次元問題: キャリア再結合: 過渡的: p-n ホモ接合フォトダイオード: 電子正孔対: 空乏領域: 中性領域: 吸収係数: 外部量子効率: 拡散長: 階段接合: 拡散電位: 電気的中性条件: 可視~近赤外波長域:

elementary charge Planck constant vacuum permittivity electron hole density mobility diffusion constant Fermi level relative permittivity electrostatic field current density continuity equation electric charge density electric flux density Gauss' law electric potential Poisson's equation one-dimensional problem carrier recombination transient homojunction p-n photodiode electron-hole pair depletion region neutral region absorption coefficient external quantum efficiency diffusion length step-contact (abrupt) junction built-in potential electrical neutrality condition visible – near infrared wavelength range 【制御工学】解答は、白色(5番)の解答用紙に記入すること.

以下の問1,問2に答えよ.

問1 伝達関数 *G*(*s*) が次式で表される線形時不変システムについて,以下の問いに答えよ.ただし, *a* は正の実数値をとるパラメータである.

$$G(s) = \frac{1000}{s^2 + as + 100}$$

- (i) ステップ応答が単調増加となるための a に関する必要十分条件を求めよ.
- (ii) a = 16 としたときのインパルス応答を時間 t の関数として表せ.
- (iii) a = 20 としたときの G(s) のボード線図におけるゲイン曲線の折れ線近似を考える.この折れ線近似において、角周波数の値が 10² となるときのゲインのデシベル値を求めよ.
- (iv) a = 20 としたとき, G(s) のベクトル軌跡が虚軸の負の領域と交差する点の座標を求めよ.
- (v) a = 10 としたとき, ゲイン $|G(j\omega)|$ が最大値をとるときの角周波数 ω の値とゲイン $|G(j\omega)|$ の最大値をそれぞれ求めよ.ただし, j は虚数単位を表す.

問2次の状態方程式と出力方程式で与えられる2入力1出力の線形時不変システムについて,以下の 問いに答えよ.

$$\frac{d\boldsymbol{x}(t)}{dt} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0\\ 0 & -a & 0\\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 & 0\\ 0 & 2\\ 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{u}(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(t)$$

ただし,
$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$$
は状態変数ベクトル, $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$ は入力変数ベクトル,

y(t)は出力変数であり、aは実数値をとるパラメータである.

(i) このシステムを表すブロック線図を図1に示す.



図中の $U_1(s), U_2(s), X_1(s), X_2(s), X_3(s), Y(s)$ はそれぞれ $u_1(t), u_2(t), x_1(t), x_2(t), x_3(t), y(t)$ のラプラス変換を表す. $G_1(s)$ および $G_2(s)$ を求めよ.

- (ii) *a* = 0 とする. このシステムの可制御性と可観測性を判定せよ. ただし, その理由を明らか にすること.
- (iii) 入力 $u(t) \in u_1(t) = u_2(t) = -y(t)$ とする出力フィードバックを施したシステムが安定となるための *a* に関する必要十分条件を求めよ.

専門用語の英訳

伝達関数	transfer function
線形時不変システム	linear time-invariant system
ステップ応答	step response
単調増加	monotonically increasing
必要十分条件	necessary and sufficient condition
インパルス応答	impulse response
ボード線図	Bode diagram
ゲイン曲線	log-magnitude curve
折れ線近似	piecewise linear approximation
角周波数	angular frequency
ゲイン	gain
デシベル値	decibel value
ベクトル軌跡	vector locus, polar plot
虚軸	imaginary axis
座標	coordinate
虚数単位	imaginary unit
状態方程式	state equation
出力方程式	output equation
状態変数ベクトル	state variable vector
入力変数ベクトル	input variable vector
出力変数	output variable
ブロック線図	block diagram
ラプラス変換	Laplace transform
可制御性	controllability
可観測性	observability
出力フィードバック	output feedback
安定	stable

図1のブロックダイアグラムに示すように,信号処理システム*S*,*L*,*H*を縦続接続する.*S*は,図2 に示すように,連続時間信号x(t)から間隔*T*秒で一様サンプリングを行い離散時間信号x[n]を得るシス テムであり,このとき,量子化は含まないものとする.*L*は,x[n]を入力として離散時間信号y[n]を出力 するシステムである.*H*は,サンプリング定理に従ってy[n]から連続時間信号y(t)を復元するシステム である.ただし,*t*は連続的な時刻を表す実数,*n*は離散的な時刻を表す整数である.



図 1: 対象とする信号処理システムのブロックダイアグラム



図 2: システム S による連続時間信号 x(t) の一様サンプリング

- (i) Lが恒等システム, すなわち y[n] = L[x[n]] = x[n]とする. また, x(t) は $x(t) = \cos(400\pi t)$ で表される正弦波であるとする. このとき,以下の問いに答えよ.
 - (a) 正弦波 x(t) の基本周期および周波数を求めよ.
 - (b) x(t)からエイリアシングなしに x[n]が得られるためには T がどのような条件を満たす必要があるか,数式を用いて答えよ.
 - (c) T = 0.004 のとき, y[n] を具体的な数式で表せ.
 - (d) T = 0.004 のとき, y(t) は何 Hz の正弦波となるか, 理由とともに答えよ.
- (ii) Lにおける入力 x[n] と出力 y[n] が次の関係式を満たすものとする.

$$y[n] = (1-a)x[n] + ay[n-1]$$

ここでaは0 < a < 1を満たす実数の定数である.また,x(t)は

$$x(t) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right), \quad \text{trill} u(t) = \begin{cases} 1 & (t \ge 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases}$$

で表される信号とする.このとき、以下の問いに答えよ.

- (a) *x*(*t*) および *x*[*n*] を図示せよ.
- (b) Lの伝達関数を求めよ.ただし、本問における伝達関数は z 変換により定義されるものとする.
- (c) 問い(b) で求めた伝達関数をもとに、Lの有界入力有界出力安定性を論ぜよ.
- (d) y[n] を具体的な数式で表せ.

	専門用語の英訳
ブロックダイアグラム	block diagram
信号処理システム	signal processing system
縦続接続	cascade connection
連続時間信号	continuous-time signal
一様サンプリング	uniform sampling
離散時間信号	discrete-time signal
量子化	quantization
サンプリング定理	Sampling Theorem
恒等システム	identity system
正弦波	sinusoidal wave
基本周期	fundamental period
周波数	frequency
エイリアシング	aliasing
伝達関数	transfer function
<i>z</i> 変換	z transform
有界入力有界出力安定性	bounded-input bounded-output stability